

Pour la première partie, on trouve que w PI est plus proche de w vrai quand la base est linéairement séparable. w PI et w Hebb ont la même performance quand la base est non-linéairement séparable.

Pour la deuxième partie, on trouve que $\log P_{gen}$ et $\log \hat{\delta}_{\tau_g}$ ont une relation linéaire. Donc la relation proposée dans la question 2.c est vérifiée. Quand $M = 1$, on peut approximer le μ_{τ_g} par τ_g .

Pour la troisième question, on trouve que PI est plus performant que Hebb sur la base d'apprentissage, ce qui est cohérent de la première partie. PI et Hebb sont autant performants sur la base de génération, mais quand P_{app} est autour de 40, la performance de PI baisse.

Mais on trouve une question que l'écart type de la deuxième partie est obtenu quand P_{app} est fixé, et on effectue 1000 réalisations, mais dans la troisième partie P_{app} change et on effectue une réalisation pour chaque valeur de P_{app} . Comment peut-on trouver l'écart type à partir de la figure de la question 3?

On trouve que sur la figure de $\tau_g - P_{app}$, les points de PI deviennent plus serrés quand P_{gen} augmente, qu'est-ce que ça montre ?

Nom: Denis

Numéro d'étudiant: 16241090

Nom: Tony

Numéro d'étudiant: 16241078